

Technologie: Post Studio

Angebot für

Bisheriges Studienmodell > Fine Arts > Bachelor Fine Arts > Grundstudium > Technologie

Bisheriges Studienmodell > Fine Arts > Bachelor Fine Arts > Hauptstudium > Technologie

Nummer und Typ	BKM-BKM-Te.17F.018 / Moduldurchführung
Modul	Technologie
Veranstalter	Departement Fine Arts
Leitung	Bea Schlingelhoff
Anzahl Teilnehmende	5 - 15
ECTS	3 Credits
Voraussetzungen	Lust am Diskutieren und Gedankenaustausch; Interesse an der künstlerischen Praxis aller SeminarteilnehmerInnen.
Lehrform	Intensive Gruppen Kritik von künstlerischen Arbeiten der teilnehmenden Studierenden. Strukturell ist das Format der Klasse von John Baldessari und später, der von Michael Asher, nachempfunden.
Zielgruppen	Studierende, die sich mit Kunst im öffentlichen Raum, mit kritischen, konzeptuellen und experimentellen künstlerischen Praktiken, Performances, mit Texten, Kunstkritik, Kunsttheorie und Philosophie auseinandersetzen und in ihrer eigenen Arbeit reflektieren.
Lernziele / Kompetenzen	In einem gemeinsamen Gespräch (pro Studierende ein ganzer Vormittag bzw. ein ganzer Nachmittag) werden Arbeiten präsentiert und in der Gruppe umfangreich und detailliert diskutiert.
Inhalte	In vier Tagen sind die Präsentierten Arbeiten der SeminarteilnehmerInnen , sowie weiterführende Aspekte, Analysen, Kritik, Diskussion, Literatur, etc.
Bibliographie / Literatur	Als Referenz: Sarah Thornton:Seven Days in the Art World, Chapter 2: The Crit, p.42ff.
Leistungsnachweis / Testatanforderung	Regelmässige, aktive Teilnahme. 80% Anwesenheitspflicht, Pünktlichkeit. Einbringen eigener Gedanken und Ideen.
	Studierende der alten Besonderen Studienordnung erhalten 4 Credits, da sie eine Zusatzleistung erbringen müssen. Die Art der Leistung wird von den Dozierenden des Moduls definiert. Sollte die Zusatzleistung nicht oder ungenügend erbracht werden, wird das gesamte Modul als "nicht bestanden" bewertet.
Termine	BW 2: 03.-06.04.17
Bewertungsform	bestanden / nicht bestanden
Sprache	Deutsch
Bemerkung	03.04 bis 06.04.17